

半導体国際会議 JSTC 開催報告

電子デバイス部

半導体業界では環境、通商、知的財産権等の国際的課題に関し、業界として対処するための国際協議・調整のスキーム〈注記〉が確立しています。日本、米国、欧州、韓国、中国及び Chinese Taipei の世界6極が定期的に一堂に会し種々の問題解決にあたるよう運営されています。JEITA 半導体部会ではこのスキームを活用し、日本の業界の要望を反映させるべく活動しております。

今回の半導体国際会議 JSTC は、平成25年2月25日(月)~3月1日(金)に米国・サンディエゴで開催され、日本からは14名が参加しました。28日の JSTC を中心に、環境、知的財産権、通商、紛争鉱物、模倣品対策等の課題について議論が行われました。主なものを紹介いたします。

環境

● 資源保全:

今回から新しい枠組みに変わり、「装置メーカーとの協業」、「半導体製品の社会貢献について研究」等活動内容についての議論をしました。

●PFC 削減:

ベストプラクティス文書を WSC の web に掲載することになりました。

• 化学物質規制:

カリフォルニア州 Safer Consumer Products 法案(カリフォルニア・グリーン・ケミストリー法)に関する最新情報を共有しました。

マルチコンポーネント IC (MCO)

昨年5月のWSCでの合意に基づいてMCOの短期間での無税化合意が最優先であることが確認されました。本年が山場となる中、75ヵ国が参加するITA品目拡大交渉にMCOが含まれるように、GAMSメンバー政府やそれ以外の政府に対し、引き続き説明等の支援活動を行なうことに合意しました。

景気刺激策

破綻しつつある企業への援助の事前通知メカニズムに関し、議論は継続されますが、日本の持論である、WTOの枠組みで十分である旨、継続して主張していきます。

知的財産権

実用新案については各極の現状の実用新案の法制度等をレビューし、実用新案制度の望ましいあり方について議論いたしました。国際的調和をめざし、現制度の改善に向けた領域を特定し、議論していくことに合意しました。また、営業秘密についての議論では各極において、法律/規則、適用分野、事例を調査し、課題を提案することになりました。

模倣品対策

模倣品対策タスクフォースを設置し、模倣 行為についての共通理解を文言化し活動の出 発点とすることが合意されました。

紛争鉱物

紛争に関与しないサプライチェーンを推進するとの観点から、WSC方針を採択することに合意し、方針声明を作成することになりました。

その他、暗号認証制度とライセンス規制、 貿易、輸出入規制、税関と貿易円滑化、マーケットレポート等についても議論致しました。

WSC に向けて

5月にポルトガル・リスボンで行われる WSC にむけて JEITA 半導体部会では、業界要望を調整し、他極との交渉方針を策定していきます。引き続きご協力をお願いいたします。

今後の日本開催

下記が日本開催となり、準備を進めています。

2014年 2月: JSTC 神戸2014年10月: GAMS 福岡

〈注記〉

国際協調・調整のスキームについて

一年間で下記のような三段階のステップを 回すことで、政府レベルまでの国際協調がは かれるようなスキームが確立されており、半 導体の関連する様々な分野について議論され ています。

- (1) JSTC (Joint Steering Committee) 半導体企業 実務者レベル会合。課題に ついて議論し、必要ならば WSC への提 案をまとめる。
- (2) WSC (World Semiconductor Council) 半導体企業 トップレベル会合。JSTC 提案を審議・承認し且つ必要に応じて各 国政府レベルに6極の業界要望をあげる。
- (3) GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors) 政府レベル協議でWSC 要望を審議決定 する。

JEITAREPORT VOL.05 Activity Report